主催: 応用物理学会 日本光学会 微小光学研究グループ

第 85 回微小光学研究会 光メモリと微小光学_高密度化の直近技術_

日時:2002 年 9 月 6 日(金) 10:30~17:00 場所:東工大すずかけ台キャンパス 総合研究館大会議室 (横浜市緑区長津田町 4259)

交通: 東急田園都市線 すずかけ台駅下車 徒歩8分



プログラム

10:30~10:35 開会の挨拶

10:35~11:10 大容量光ストレージの将来展望

11:10~11:35 青紫色半導体レーザー

11:35~12:00 NA=0.85単玉対物レンズ

12:00~12:25 青色/DVD/CD互換光ヘッド

横森 清(リコー)

竹谷 元伸(ソニー)

糸長 誠(日本ビクター)

片山 龍一(NEC)

12:25~13:30 <昼食休憩 65 分>

13:30~13:55 近接場光記録用の集光系と半回転放物面型ソリッドイマ・ジョンミラーの作製

上柳 喜一(富士ゼロックス)

13:55~14:20 ナノ光メモリ媒体

内藤 勝之(東芝)

14:20~14:45 2 光子吸収を用いた3次元多層光メモリ

川田 善正(静岡大)

14:45~15:10 偏光コリニアホログラフィー

堀米 秀嘉(オプトウエア)

15:10~15:40 <休憩 30 分>

15:40~16:05 赤レーザーを用いた2インチ3GB光磁気ディスク

尾留川 正博(松下電器)

16:05~16:30 多値記録再生技術による光ディスクの高密度化

林 英樹(パイオニア)

16:30~16:55 近接場マスク露光 - 微小光学素子作製への応用可能性 -

黒田 亮(キヤノン)

16:55~17:00 閉会の挨拶

参加費:一般4,000 円、学生1,000 円(資料代含む、当日ご持参ください)

参加申込:不要(直接会場にお越しください)

担当委員:横森 清(リコー)、半田祐一(キヤノン)、大塚由紀子(東京大学)、森 伸芳(コニカ)

問合せ先:コニカ株式会社 オプト&EMテクノロジーカンパニー オプト事業部 森 伸芳

電話: 0426-60-9315 Fax: 0426-60-9325 E-mail: n.mori@konica.co.jp

微小光学研究グループ: 代表 伊賀健一: 運営委員長 後藤顕也: 実行委員長 中島啓幾、國分泰雄

プログラムは、微小光学研究グループのホームページhttp://www.din.or.jp/microopt/でもご覧になれます。